



事例集

所属部署

ナノテクノロジープラットフォーム部署

技術開発・共用部門

微細加工プラットフォーム

共用施設の部署

設置地区

ナノファブリケーション

酸化膜ドライエッチング装置 + 電子ビーム描画装置

千現

試料材質:

設備名

事例: 量子ドットの創製

事例のタイトル

試料履歴:

どんな試料?

適用範囲:

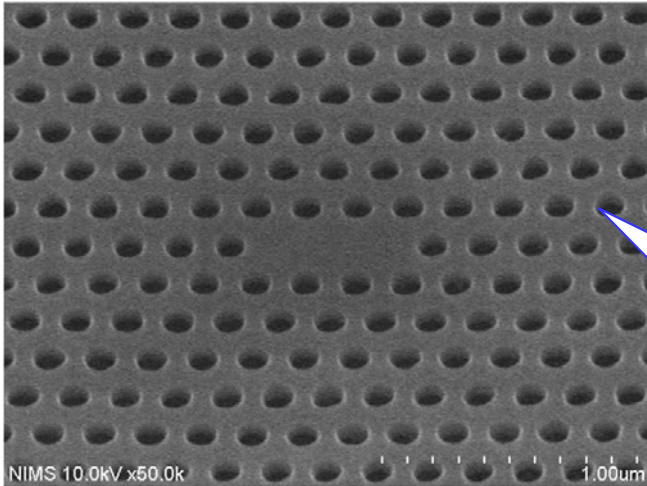
設備の仕様など

量とかサイズ:

どのくらい作る? or 対象とするもののサイズ

事例集のご案内

設備の写真



ユーザー開放装置 (使い方の講習会も行っています)

結果は、
図解
グラフ
写真
等

酸化膜ドライエッチング装置

電子ビーム描画装置



NIMSにおける
特徴

特徴:
高精度電子ビームリソグラフィー
およびドライエッチング装置を使って
新たな量子ドットを創製。

材料分析ステーション

所属部署

試料の材質成分等

微小部蛍光X線分析装置

設置地区

千現

NIMSにおける特徴

試料材質: プリント基板

試料形状: 不定形試料にも対応

サイズ範囲: 最大270×270×100mm

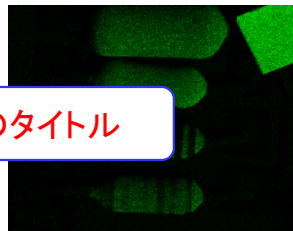
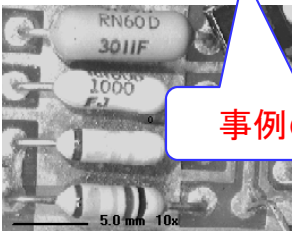
特徴: 試料の履歴、均質性、想定不純物等

ポリキャピラリーで集束させた1次X線を試料の微小部に照射し、発生する蛍光X線を半導体検出器で測定する。線分析、マッピングが可能。

NIMSにおける指導

事例: プリント基板の定性分析

ユーザー解放装置: 講習会受講後、ライセンスを付与

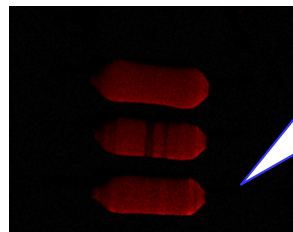
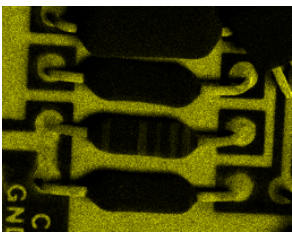


事例のタイトル

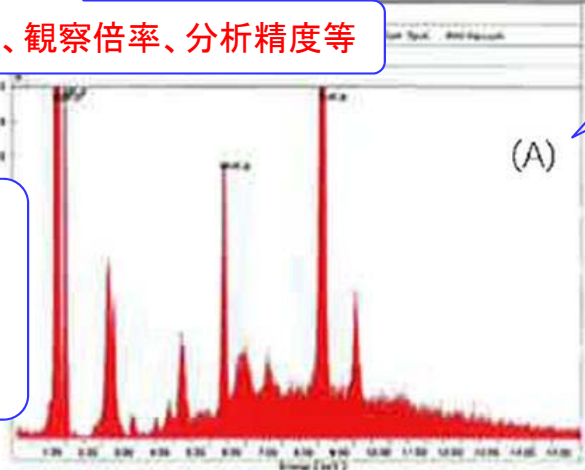
製作量、観察倍率、分析精度等

モニタージュ画像

Si Kα線



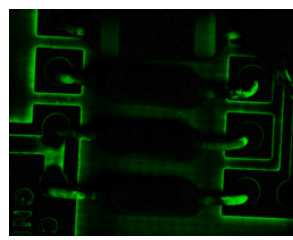
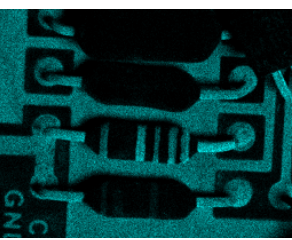
図解
グラフ
写真
等



Mg合金試料のモニタージュ画像(B)とSDD検出器で測定したスペクトル(A)

Sn Lα線

Ti Kα線



Pb Mα線

Cu Kα線



設備の写真

設備の型式、仕様、適用範囲

微小部蛍光X線分析装置 Orbis I